(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2007 年10 月11 日 (11.10.2007)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/113955 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/027 (2006.01) *H01L 21/68* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2007/053723

(22) 国際出願日: 2007 年2 月28 日 (28.02.2007)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2006-095982 2006 年3 月30 日 (30.03.2006) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社ニコン (NIKON CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008331 東京都千代田区丸の内３丁目２番３号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 田中 慶一 (TANAKA, Keiichi) [JP/JP]; 〒1008331 東京都千代田区丸の内３丁目２番３号 株式会社ニコン内 Tokyo (JP).

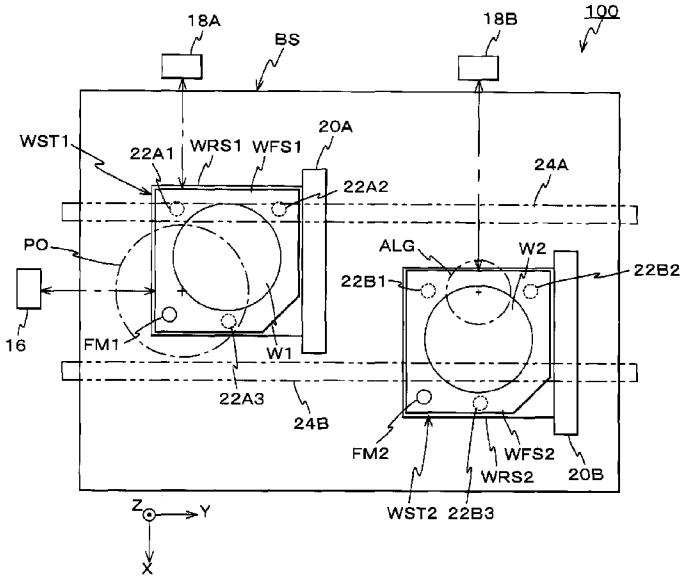
(74) 代理人: 立石 篤司 (TATEISHI, Atsuji); 〒2060035 東京都多摩市唐木田一丁目５３番地９ 唐木田センタービル 立石国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,

[続葉有]

(54) **Title:** MOBILE DEVICE, EXPOSURE DEVICE, EXPOSURE METHOD, MICRO-MOTION BODY, AND DEVICE MANUFACTURING METHOD

(54) 発明の名称: 移動体装置、露光装置及び露光方法、微動体、並びにデバイス製造方法



(57) **Abstract:** Since power transmission/waste heat frames (24A, 24B) can always absorb heat radiated from wafer stages (WST1, WST2), it is possible to suppress affect of heat generated in the wafer stages (WST1, WST2) to an exposure accuracy. In this case, there is no need of connecting an external tube for supplying a coolant to the wafer stages (WST1, WST2) as in the prior art. Accordingly, it is possible to prevent lowering of the motion accuracy of the wafer stages (WST1, WST2) by the tension of the tube, which in turn maintains a high exposure accuracy.

(57) 要約: 送電・廃熱フレーム（２４Ａ，２４Ｂ）が、ウエハステージ（ＷＳＴ１、ＷＳＴ２）から輻射した熱を常時吸収することができるので、ウエハステージ（ＷＳＴ１、ＷＳＴ２）において発生する熱による露光精度への影響

[続葉有]

WO 2007/113955 A1

OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

を抑制することが可能となる。この場合、従来のように、ウエハステージ（ＷＳＴ１、ＷＳＴ２）に冷媒を供給する配管（チューブ）を外部から接続する必要がないため、配管の張力によるウエハステージ（ＷＳＴ１、ＷＳＴ２）の移動精度の低下を防止することができ、この点からも露光精度を高精度に維持することが可能となる。